

最近の化学工学講習会 68

—塗布・乾燥技術の基礎とものづくり:新素材の利用と次世代デバイスへの展開—
報告書

山村方人(九州工業大学)(文責)

2020年1月20～21日に早稲田大学西早稲田キャンパスにて最近の化学工学講習会68を化学工学会関東支部主催・化学工学会材料・界面部会 塗布技術分科会共催で実施した。詳細は下記の通りである。

日時	1月20日 9:25～18:15 (講演 11件) 1月21日 10:00～17:00 (講演 8件)
会場	早稲田大学西早稲田キャンパス 55号館 第2会議室
聴講者数	90名(産 86名, 学 4名)
講演	『種々の塗布方式の歴史と変遷』宮本 公明 氏(元富士フイルム株式会社) 『塗布流動の基礎』津田 武明 氏(ダウ・東レ株式会社) 『レオロジーの基礎』菰田 悦之 氏(神戸大学) 『スラリー分散・凝集制御』森 隆昌 氏(法政大学) 『流れと表面張力』本間 俊司 氏(埼玉大学) 『スロットダイ塗布』笹野 祐史 氏(株式会社ヒラノテクシード) 『グラビア塗布の概要およびプロセス管理』三浦 秀宣 氏(富士機械工業株式会社) 『電子線の産業利用』武井 太郎 氏(岩崎電気株式会社) 『赤外線を用いた塗布膜乾燥プロセスの特徴と効果』近藤 良夫 氏(日本ガイシ株式会社) 『最近の学術動向と計測評価手法の進展』山村 方人 氏(九州工業大学) 『印刷型有機集積回路とIoTセンサ応用』時任 静士 氏(山形大学)

<p>『ウェアブル・デバイスの印刷形成と材料に求められる課題』沼倉 研史 氏 (DKNリサーチ)</p> <p>『微細印刷のパターニング原理と応用プロセス』日下 靖之 氏 (産業技術総合研究所)</p> <p>『二次電池、燃料電池の電極スラリーモデルのレオロジー』中村 浩 氏 (株式会社豊田 中央研究所)</p> <p>『クレーストソリューションキャストリングによる高付加価値製品開発』蛭名 武雄 氏 (産業技術総合研究所)</p> <p>『セルローズナノファイバーの構造・基礎特性と塗布・乾燥分野への応用と課題』磯貝 明 氏 (東京大学)</p> <p>『塗布乾燥シミュレーション』富塚 孝之 氏 (株式会社アドバンスト・ソフト)</p> <p>『ナノ粒子の表面設計による液中分散制御』飯島 志行 氏 (横浜国立大学)</p> <p>『乾燥に伴う界面変形 :液液および固液界面での物質移動』稲澤 晋 氏 (東京農工大学)</p>
--

以上